



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



لایه نشانی و مشخصه یابی فیلم نازک باریم استرانسیم تیتانایت به روش لایه نشانی لیزر پالسی

هاجر کاظمی^۱، زهرا سادات عزیزی^۲، سیده مهتری حمیدی^۲، محمد مهدی طهرانچی^۱ و مرتضی مظفری^۳

^۱دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
^۲پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
^۳دانشکده فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده - فیلم‌های نازک فرو الکتریک کاربرد وسیعی در قطعات میکروالکترونیکی دارند. در این قطعات وجود تابعیت غیر خطی ثابت دی الکتریکی به میدان الکتریکی ضروری است. از جمله مواد فرو الکتریک مناسب، باریم استرانسیم تیتانایت است. در این جا باریم استرانسیم تیتانایت با ترکیب شیمیایی $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$ به روش لایه‌نشانی لیزر پالسی بر روی زیرلایه $Pt/Ti/SiO_2/Si$ لایه نشانی شده است. نتایج لایه نشانی از جمله خصوصیات ساختاری و مورفولوژی سطح فیلم، به ترتیب با پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شده است.

کلید واژه - باریم استرانسیم تیتانایت، لایه نشانی لیزر پالسی، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ نیروی اتمی.

The Deposition and characterization of barium strontium titanate thin film by the pulsed laser deposition method

Hajar Kazemi¹, Zahra Sadat Azizi², Seydeh Mehri Hamidi², Mohammad Mehdi Tehrani^{1,2} and Morteza Mozafari³

¹Department of physics, Shahid Beheshti University, Tehran

²Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

³Department of physics, Esfahan University, Esfahan

Abstract- The Ferroelectric thin films are widely used in microelectronic devices. It is important for these devices to have nonlinear dependence on electrical field. A good candidate is Barium Strontium Titanate (BST). BST thin film ($Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$) has been deposited on $Pt/Ti/SiO_2/Si$ substrates by pulsed laser deposition method with different area of one. The structure characterization and surface morphology of the BST thin films was performed by X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM).

Keywords: Barium Strontium Titanate, Pulsed laser deposition, X-ray diffraction, Atomic force microscopy.

۱- مقدمه

در دهه‌ی اخیر، فیلم نازک باریم استرانسیم تیتانیت^۱ (BST) در حافظه‌های DRAM [۱]، خازن‌های کنارگذر [۲]، آشکارساز فرو سرخ [۳] و ابزار کوک‌پذیر میکروویو [۴] مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کاربردها عموماً از مواد فروالکترونیک دارای سرب استفاده می‌کنند. ماده BST، به علت پایداری گرمایی خوب، وابستگی غیرخطی ثابت دی الکترونیک به میدان الکترونیک و سازگاری با محیط زیست در مقایسه با فیلم‌های نازک دارای سرب، مورد توجه قرار گرفته است [۳].

در این مقاله، لایه نشانی فیلم نازک باریم استرانسیم تیتانیت برای استفاده در قطعات کوک‌پذیر میکروویو گزارش شده است. خصوصیات الکترونیک فیلم باریم استرانسیم تیتانیت تاثیر بسزایی در عملکرد قطعه دارد. تفاوت بین ثابت شبکه‌ی زیرلایه و فیلم یکی از عوامل موثر بر خصوصیات الکترونیک فیلم است. با توجه به نزدیکی ثابت شبکه پلاتین (39/2nm) به فیلم باریم استرانسیم تیتانیت (39/4nm) در اینجا از Pt/Ti/SiO₂/Si به عنوان زیرلایه استفاده شده است.

فرآیند ساخت فیلم نازک BST و شرایط لایه نشانی تاثیر بسزایی بر خصوصیات الکترونیک فیلم نازک دارد. برای ایجاد فیلم نازک باریم استرانسیم تیتانیت روش‌های لایه نشانی متعددی از جمله سل-ژل^۲، RF Sputtering، لایه نشانی بخار شیمیایی فلز آلی^۳ (MOCVD) و لایه نشانی لیزر پالسی^۴ (PLD) مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱،۴].

در این مطالعه، فیلم نازک BST نیاز به استوکیومتری شیمیایی و رشد همبافته بر زیر لایه دارد. در اینجا برای کنترل استوکیومتری و کیفیت بالای فیلم، از روش PLD استفاده شده است. و برای بررسی ساختار بلوری فیلم و موفولوژی سطح آن به ترتیب پراش اشعه‌ی ایکس^۵ (XRD) و میکروسکوپ نیروی اتمی^۶ (AFM) بکار رفته است.

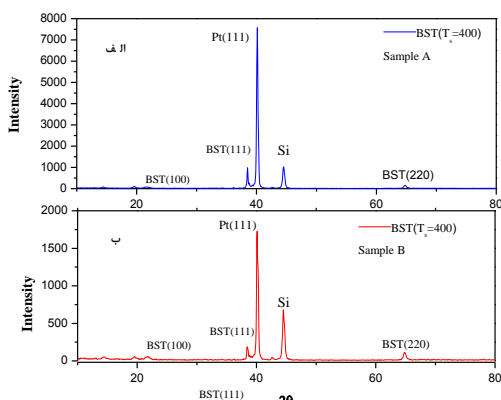
۲- روش تجربی

در این مقاله باریم استرانسیم تیتانیت (Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO₃) بر روی زیرلایه‌ی Pt/Ti/SiO₂/Si با روش PLD لایه نشانی شده است. فرآیند رشد فیلم نازک در محفظه خلا در فشار 10⁻⁶ میلی بار با استفاده از هارمونیک سوم لیزر Nd:YAG با طول موج (1054nm)، انرژی بر پالس (60mJ)، طول پالسی (10ns) و نرخ تکرار (10Hz) انجام شده است. باریم استرانسیم تیتانیت روی دو زیرلایه‌ی A و B از جنس Pt/Ti/SiO₂/Si و به ترتیب با مساحت‌های (2mm²) و (4mm²) که در فاصله‌ی 30mm از هدف و در دمای 400^oC قرار دارد، لایه نشانی شده است.

در ادامه با پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)، ساختار بلوری و میکرو ساختار فیلم نازک باریم استرانسیم تیتانیت، تحلیل شده است. با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ناهمواری و مورفولوژی سطح بررسی شده است.

۳- مشخصه یابی لایه نازک BST

نمودار XRD لایه نازک باریم استرانسیم تیتانیت لایه-نشانی شده بر روی دو زیر لایه با مساحت‌های متفاوت در شکل ۱ آمده است. شکل (الف) پراش اشعه‌ی ایکس از نمونه‌ی A را نشان می‌دهد. در این شکل بازتاب از صفحات BST(111)، BST(100) و BST(220) مشاهده می‌شود که شدت بازتاب از صفحه‌ی (111) بیشتر است. بنابراین فیلم به صورت بس بلور و در راستاهای ذکر شده و با جهت ترجیحی (111) رشد یافته است.



شکل ۱. تحلیل ساختاری با پراش اشعه‌ی ایکس. (الف) نمودار XRD نمونه‌ی A با مساحت زیرلایه (2mm²) و (ب) نمودار XRD نمونه‌ی B با مساحت زیرلایه (4mm²).

¹ Barium Strontium Titanate

² Sol-gel

³ Metal organic chemical vapor deposition

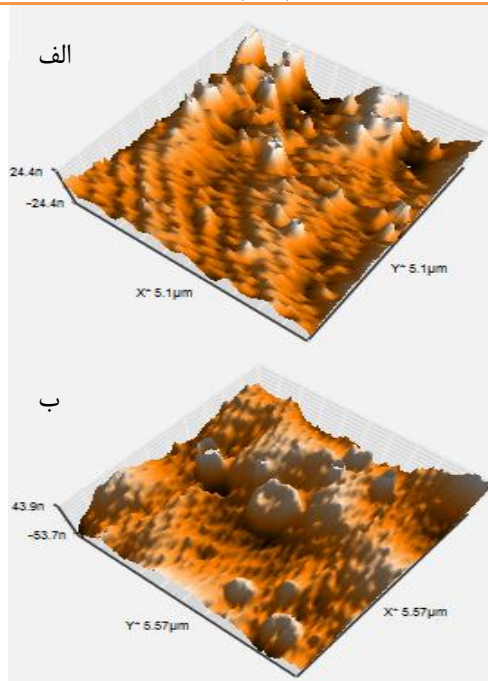
⁴ Pulsed laser deposition

⁵ X-Ray Diffraction

⁶ Atomic Force Microscopy

جدول ۱. خلاصه نتایج XRD نمونه‌های رشد یافته در دمای ۴۰۰ درجه و مساحت زیرلایه‌ی متفاوت.

نمونه	صفحه	زاویه(درجه)	پهنا در نصف طول بیشینه (درجه)	ارتفاع پیکها(cts)	فاصله‌ی بین صفحات (انگستروم)
A(2mm ²)	(۱۱۱)	38/46	0/21	580/61	2/33
	(۲۲۰)	64/74	0/43	99/91	1/43
	(۱۰۰)	21/35	1/15	31/55	4/15
B(4mm ²)	(۲۲۰)	64/75	0/5	74/43	1/43
	(۱۱۱)	38/41	0/28	119/7	2/34
	(۱۰۰)	21/75	0/86	23/36	4/08



شکل ۲. بررسی مورفولوژی و ناهمواری سطح با میکروسکوپ نیروی اتمی. الف) میکروگراف AFM سه بعدی نمونه‌ی A (ب) میکروگراف AFM سه بعدی نمونه‌ی B.

۴- نتیجه‌گیری

فیلم نازک باریم استراتیم تیتانیت با ترکیب شیمیایی $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$ روی زیرلایه‌ی Pt/Ti/SiO₂/Si با روش لایه نشانی لیزرپالسی ایجاد شده است. ساختار بلوری و میکروساختار فیلم با روش XRD، مورفولوژی و ناهمواری سطح با AFM مشخص شده است. فیلم‌های نازک ایجاد شده ساختاری بس بلور، سطحی بدون شکاف و ناهمواری سطحی کوچکی دارند. این نتایج نشان می‌دهد که روش لایه نشانی لیزر پالسی در ایجاد فیلم‌های نازک باریم استراتیم تیتانیت با کیفیت بالا بر روی زیر لایه‌ی Pt/Ti/SiO₂/Si کارایی بالایی دارد.

شکل (۱ب) پراکندگی اشعه‌ی ایکس از فیلم نازک BST لایه‌نشانی شده روی زیرلایه B را نشان داده است. در این فیلم نیز بازتاب از صفحات BST(100)، BST(111) و BST(220) مشاهده می‌شود که شدت بازتاب از دو صفحه‌ی (111) و (220) تقریباً یکسان است. بنابراین این فیلم بصورت بس بلور و بدون جهت ترجیحی رشد یافته است. با استفاده از معادله‌ی شرر^۷ ($d = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos \theta}$) سایز ذرات نمونه‌ی A، ۲۲/۹۸ نانومتر و نمونه‌ی B، ۲۳/۸۷ نانومتر بدست آمده است. ارتفاع پیکها، پهنا‌ی نصف طول بیشینه^۸ (FWHM) و فاصله‌ی بین صفحات (d-spacing) برای دو نمونه در جدول (۱) آمده است.

برای مطالعه و بررسی مورفولوژی و ناهمواری سطح فیلم دو نمونه‌ی A و B از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شده است. در شکل (۲) میکروگراف AFM سه بعدی از سطح فیلم‌ها آمده است. در هر دو شکل الف و ب هیچ گونه شیار طولانی و یا چاله عمیقی مشاهده نمی‌شود، بنابراین در سطح فیلم‌ها شکاف و یا ناحیه‌ی کوچکی با سطح آزاد وجود ندارد. شکل (۲ الف) گراف سه بعدی از AFM سطح نمونه‌ی A نشان می‌دهد. برای این نمونه ناهمواری میانگین^۹ 6/52 نانومتر و جذر مربع میانگین^{۱۰} (RMS) ناهمواری سطح 9/12 نانومتر است. برای نمونه‌ی B ناهمواری میانگین 13/72 نانومتر و RMS ناهمواری 17/85 نانومتر است. در شکل (۲ب) گراف سه بعدی از AFM سطح آن آمده است.

⁷ Sherrer equation

⁸ Full Width at Half Maximum

⁹ Average roughness

¹⁰ Root-mean square

مراجع

- [1] Ashok.Kumar, Sriraj G.Manvalan, *Characterization of barium strontium titanate thin films for tunable microwave and DRAM application*, Surface & Coating Technology, vol.198, pp.406, 2005.
- [2] Kazuaki Kurihara, Tekeshi Shioga, John D.Baniecki, *Electrical properties of low-inductance barium strontium titanate thin film decoupling capacitors*, Journal of European Ceramic Society, vol.24, pp.1873, 2003.
- [3] Koppole C.Sekhar, et al, *Enhanced dielectric and tunable characteristics of K-doped $Ba_{0.5}Sr_{0.5}TiO_3$ thin films prepared by pulsed laser deposition*, Thin Solid Films, vol.527, pp.267, 2013
- [4] P Bao, T.J.Jackson, X Wang, M.J.Lancaster, *Barium strontium titanate thin film varactors for room temperature microwave device applications*, J. Phys. D: Appl. Phys, vol.41, pp.063001, 2008